

「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開  
／有機ケイ素先端材料開発技術者養成に係る特別講座」

# NEDO特別講座Q単位シロキサン化合物の 製造技術、分析評価技術講座ワークショップ

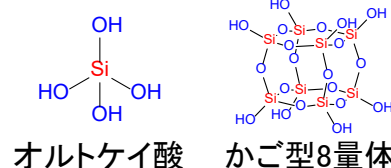
日時

2024年3月1日(金)

13時30分～18時00分 (受付時間13時00分～13時30分)

対象者

企業の研究者・開発者、大学教員・学生



内容  
(予定)

- 13:00-13:30 受付  
13:30-13:40 開会挨拶・趣旨説明  
13:40-14:30 ゾル・ゲル法によるポリシロキサン合成  
(東京理科大学 郡司天博 教授)  
—休憩—  
14:30-14:40 —休憩—  
14:40-15:30 オルトケイ酸( $\text{Si}(\text{OH})_4$ )とそのオリゴマーの単離および構造解析  
(産総研 五十嵐正安 上級主任研究員)  
—休憩—  
15:30-15:40 —休憩—  
15:40-16:30 水溶液プロセスによる低密度柔軟シリコン多孔体  
(京都大学 金森主祥 助教)  
—休憩—  
16:30-16:40 —休憩—  
16:40-17:30 シルセスキオキサンおよびシロキサン類の構造制御合成(仮題)  
(鹿児島大学 金子芳郎 准教授)  
17:30-17:40 質疑応答・閉会  
17:40-18:00 —移動—  
18:00-20:00 懇親会

お申込み

<https://forms.office.com/r/r0wLfzsaDd>

※只今申込を受け付けています。申込締切:2024年2月19日(月)



会場

産業技術総合研究所 つくば中央 第五事業所5-2棟 6603室  
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1

お問い合わせ

産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 五十嵐正安

Tel: 029-861-9387

E-mail: M-silicone-kouza-ml@aist.go.jp